

Procedeu de obținere a compozitului fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf și polimer organic, care include amestecarea componentelor, omogenizarea amestecului obținut, depunerea pe suport și uscarea lui, caracterizat prin aceea că se amestecă și se omogenizează soluția de  $As_2S_3$  sau  $As_2Se_3$  în monoetanolamină cu soluția metanolică de poli-N-vinilpirolidonă, la temperatura de 20...40°C, iar amestecul depus se usucă la temperatura de 40...50°C în termostat, timp de 5...6 ore, apoi în vid timp de 3...4 ore, cu obținerea unui compozit având următorul raport al componentelor, % mas.:

semiconductor calcogenic	10,0...87,0
polimer organic	restul.